This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-216000

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和63年(1988)9月8日

G 21 K 4/00 G 03 B 42/02 42/04 8406-2G

Z - 7811 - 2H Z - 7811 - 2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全9頁)

€発明の名称

加熱乾燥手段を有するX線写真増感用蛍光体パネル

②特 頤 昭62-50796

29出 願 昭62(1987)3月4日

⑫発 明 蹇 者 土 野 久 ②発 明 者 加野 亜 紀 子 明 ⑫発 者 邦 中 野 昭 ⑫発 眀 者 島 田 文 生 阋 ②出 コニカ株式会社 東京都日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内 東京都日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内 東京都日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内 東京都日野市さくら町1番地 小西六写真工業株式会社内 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

pЛ 纽

1. 発明の名称

加熱乾燥手段を有するX線写真増癌用 低光体パネル

2. 特許額求の範囲

X級照射時に蛍光を発する蛍光体を用いるX級 写真增照用蛍光体バネルに加熱乾燥手段を組込ん だことを特徴とするX級写真増感用低光体パネル。 3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は医学用X線写真の直接撮影用増感スク リーン成は間接撮影用蛍光スクリーンに関する。 【発明の背景】

直接撮影用増盛スクリーン (intensifying scre en、一般に増感紙と呼ばれる)及び間接撮影用低 光スクリーン(fluorescent screen、一般に蛍光 板と呼ばれる)は、X級によって蛍光を発する蛍 光体を、X線撮影に支障のない支持体上に遊改し、 更に形成された蛍光体層を保護層で被覆したもの である。前記増感紙は支持体の表面にハロケン化

盤 感 光 層 が 盗 設 さ れ た 写 攻 感 光 材 料 (X レ イ フィ ルム)に密ガをせられて保持され、X 線が肌射さ れることによって発光し、写真感光材料のX板に 対する感度を間接的に向上させている。また低光 板に於てはX級像を可視頭像に変換し、これを肌 換扱彫用カノラあるいは撮影管等で撮影可能にし ている。

前記地感紙、蛍光板等の蛍光スクリーンは一般 にパネル形態をなしているので以後の説明には両 者を一括してX線写真均感用蛍光体パネル、更に 省略して蛍光体パネル或は単にパネルと称する。

前記増感紙に使用する蛍光体は、従来一般的に 直接撮影用Xレイフィルムの燃色性がレギュラー である場合には4000~5000Aに蛍光スペクトルを 有するタングステン酸カルシウムを主系統とした **蛍光体ユーロピウム 仄活硫酸 パリウム 蛍光体等が** 用いられ更に直接撮影用Xレイフィルムの感色性 がオルソマチックの場合にはテルビニウムを妖活 別とした酸化硫化カトリニウム系の5400A付近に ピークを存する蛍光体等が用いられている。また

1)

Japanese Patent un-examined Publication No. sho 63-216000

Publication Date: September 8, 1988

Title of the Invention: A fluorescent panel for sensitizing X ray photograph with drying

-by-heating means

Application No. sho 62-50796

Application Date: March 4, 1987

Inventors: Hisanori TSUCHINO

Kuniaki NAKANO

Humio SHIMADA

Applicant: KONICA KK

Claim:

A fluorescent panel for sensitizing X ray Photograph characterized by drying -by-heating means which is incorporated into said luminescent panel using fluorescence material emitting fluorescence at the radiation of X-ray.

In Fig. 1,

1: a supporting member

2: a fluorescent layer

3: a protective layer

1H: a heating supporting member

2H: a heating fluorescent layer

3H: a heating protective film

H1, H2, H4: a heating layer

H3: a supporting heating body

In the specification, it is described that "a supporting heating body in which heating member itself has a function as a supporting member also, may be "a carbon fiber sheet".

間接扱影用Xレイフィルムの感光性はオルソマティックであるので前記蛍光板は5400~5500Aに蛍光スペクトルを有する質を以活剤とする硫化カドミウム亜鉛系のものか使用される。

ところで前記蛍光休は、まづX線エネルギーの 吸収効率のよいこと、発光効果のよいこと、写真 感光材料の感光スペクトルを効率よくカバーする 飲光スペクトルを発すること、 現光がなく 画像の 鮮鋭性、 強影操作に支障を与えぬことが要求され る。

ここに於て、LaOBr:Tb等の希土類蛍光体、BaFBr:Eu、BaFCl:Eu等のアルカリ土類蛍光体はX線の吸収効率、発光効率が高く発光スペクトル領域も好遇であり、X線写真増感用蛍光体として好しい。またCal:Na、Cal:Tl、RbBr:Tl等のアルカリハライド蛍光体は前記性能を備えると共に蒸着等の気相堆積法によって容易に蛍光体層を形成できるので蛍光体層中の蛍光体充填密度が100%に近く結准剂溶液に蛍光体粒子を思氮、分散させた蛍光体数料を塗布した蛍光体層に比べ感度、粒块性及

対処するため特性を犠牲にして吸湿性の少い世光体を選び且つ必要に応じ世光体層面を保護層で被 限する方法がとられてきた。

この保護層は、たとえば特別昭59-42500号に記述されているように、保護層用旅布限を蛍光体層上に直接盤布して形成されるか、あるいはあらかじめ別途形成した保護層を蛍光体層上に接着する方法により形成されている。

しかし、前記保護用は用厚を厚くして水分の迅 適平を下げようとする必要があり、水分の透透 ため間間化する必要があり、水分の透光 完全に防止することは不可能であった。このかか が配 BaFBr: Euのようなアルカリ金風系の鍛光体、の ないは La OBr: Tt 做光体等の吸湿性が若しい飲光体は 吸湿による特性の劣化が起こりこれら飲光体は 吸湿による特性の劣化が起こりこれら飲光体は 吸収吸効率、発光効率などの説特性が優れている はしかかわらず、 X 級写真増熱用徴光体として利 用することは困難であった。

前記世光体パネルの耐用性を向上するために符

び国像の姓似性が著しく向上して好ましい。

また更に近光体パネルには最迟し使用が可能で あること(耐用性)が強く要求される。

叩ち、前記俊光休パネルは、役られるX級函像 の匹質を劣化させることなく氏切りあるいは多数 回の殺乏しの使用に耐える性能を有することが望 まれる。そのためには前記位光体パネル中の位光 体層が外部からの動理的あるいは化学的耐温から 十分に保設される必要がある。しかしなから蛍光 体は一般に吸湿性であり、とくに前記者土類、ア ルカリ土類取はアルカリハライド系の<u>飲光体は限</u> <u>湿性が強い。</u> 前記世光休周が水分を吸収すると、 アルカリ土類系蛍光体(例えばBaFBr:Eu)等は分解 しX線に対する感度が低下する。またアルカリハ ライド系蛍光体(例えばCsl:Na) 符は吸湿、脱湿に .よりX線に対する感度が変動し、撮影条件が不安 定となり、また得られるX級国像の頭質の劣化を らたらすため、前記蛍光休暦に水分が含有されな いよう保護することが望まれる。

従来の蛍光体パネルにおいては、上記の間別に

に耐湿性防湿手段の点でのよりいっそうの改良が 望まれているが、前記保護圏の透湿性を低下をせ るための方法以外は防湿性に関してほとんど検討 されていないのが現状である。

【発明の目的】

本見明は、低光体パネルにおける前述のような現状に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は低光体層の乾燥度を保ち、長期間にわたり良好な状態で使用が可能である蛍光体パネルを提供することにある。

【発明の構成】

前記した本発明の目的は、X級照射時に蛍光を発する蛍光体を用いるX級写真増燃用蛍光体パネルに加熱乾燥手段を組込んだことを特徴とするX級写真増感用蛍光体パネルによって達成される。

尚本発明の想換として前記加熱乾燥手段は蛍光体パネルの構成圏、支持体中に含有組込まれてもよいし、発熱体からなる層を別途設けてもよい。

次に本発明を具体的に説明する。

X級照射時位光を発する位光体を用いる位光体

パネルは、一般に支持体上に蛍光体層(以後蛍光層と略称する)と該蛍光層の機能を補充するための各種構成層(例えば保護層、フィルタ層或は接着層等)からなっている。

第1図に本発明の蛍光体パネルの各種塑料を例示する。

第1図(a)において、1は支持体、2Hは乾燥乾燥用発熱体(以後免熱体と略称する)が含有組込まれた発熱蛍光層、3は保護層である。尚該保護層が蛍光層の周側面まで数質する例を示した。同図(b)は蛍光層2に対する支持体1の裏面に発熱体からなる発熱層目が支持体1に投して殴けられており、同図(c)において発熱体からなる発熱層目2は支持体に関し蛍光層2と同側、支持体に接して設けられ、保護層3は蛍光層2のみの全表面を披護している。同図(d)において1Hは支持体中に発熱体が含有組込まれた発熱支持体である。同図(e)においては、113は発熱体自身が支持体を兼ねる支持発熱体であり、保護層3が蛍光層2及び支持発熱体であり、保護層3が蛍光層2及び支持発熱体にあり、保護層3が蛍光層2及び支持発熱体13の英面を含め全表面を包んで被視している。

バネルの乾燥もしくは防湿のための加熱温度範囲は40~150℃、好しくは40~80℃であって、該温度範囲においては、支持体、保護層に非耐熱性業材(例えばポリエチレンテレフタレート等)使用の自由が許される。また加熱温度が高すぎると、X級照射時に蛍光層の感度低下を生じたり、 残光量が増大したり、 写真感光材料が熱カブリを生じたりして好しくない。

加烈の時期はX級回像を与えるX級照射時および/または非照射時の任意時期でよい。乾燥に要する時間は含湿により30%相対感度に低下したパネルに於ても80℃で1.0~2.0時間ではは100%に回復できる。尚久相堆板による結カ剤フリーの蛍光圏の方が乾燥効率(悪度回復速度)かよい。

また照射時よりも非照射時の加熱温度を高め乾 燃効果を上げる等の方策を跳じてもよいし、照射 時は加熱を中止するようにしてもよい。

また使用の皮質に逐次乾燥処理を行ってもよい し、夜間等の非使用時頃は蛍光体が水分により分 解しその機能回復不能に陥入らない限度の長期貯 同図(1)は発熱層 114が低光間 2 の上面に接して殴けられ、同図(8)では低光層 2 が発熱層 112 および 114に 差決まれた態様である。同図(b)は発熱体が含有組込まれた発熱保護層 311を有する例である。

本発明のパネルは上例に限らないが、発熱体からなるが近は発熱体が含有超込まれた圏が世光圏と写真磁光材料との間に位置する場合には、該パネル該発熱体圏は蛍光に対し透明な物質が用いられる。

前記発熱体が含有組込まれた個あるいは発熱支持体には<u>カーボンブラック</u>、金風微粉末等の遊光 性微粉末を用いられることが好しい。

また預別体からなる発別層には、透明な酸化インジウム等の電気抵抗体の金属酸化物或は金属等の蒸剤、スパッタリングによる寝扱、またはカーポンプラック、金属微粉末等を分放態濁する塗料の強布級が用いられる。

また、前記弱熱体自身が支持体を兼ねる支持発 熱体には、<u>カーボンファイベシート等が用いら</u>れるの

賀後に一括除湿処理を行ってもよい。

前記した想線例のように発熱体をパネルに組込む場合、発熱体は電流回路を形成しパネル全面に充分加熱効果を及しうる形想及び配置に関る支障を避けた形態であれば如何様のパターンを採ってもよい。その例を第2回に示す。同図(a)は発熱体に均一種周回路を形成させた例であり、同図(b)は構型、同図(c)は風曲単線型回路とした例である。第2回においてPは電板、IIは発熱体である。

次にパキルの乾燥温度制御は熱電対等の温度検出器に温度制御器、ヒータ用電源を組合せることによって容易に行うことができる。第3回にその1例のブロック図を示した。

また別個に加熱・乾燥装置を併用いてもよい。 次に本発明のパネルの除湿効率の一例を第4図に示す。該パネルの構造は第1図(c)の仕様であり、蛍光体としてはCsl:Na蛍光体を用いている。

また第 5 図に前記パネルの蛍光層の含水率(水 18/珂尽服 9)と蛍光発光強度の関係を示す。

図に明かなように蛍光層の加熱により、該層の

除湿及び防湿がなされ、パネルの耐用性が保証される。

また、これら支持体の周厚は用いる支持体の材質等によって異なるが、一般的には80μ=~1000μ=であり、取扱い上の点から、さらに好ましくは150μ=~500μ=である。

これら支持体の表面は滑面であってもよいし、 低光層との接着性を向上させる目的でマット面と してもよいしまた下引層を殴けてもよい。

あってもよい.

上記低光体のうち特に水分に弱い 蛍光体は、La OBr:Tb: R 蛍光体、アルカリ土類金属 R 蛍光体、アルカリ土類金属 R 蛍光体、アルカリ金属 R 蛍光体であり、これら蛍光体に本発明を適用するとその効果は特に大きい。

本発明のパネルは前記の蛍光体の少なくとも一種類を含む一つ若しくは二つ以上の蛍光層から浪る蛍光層群を有してもよい。また、それぞれの蛍光圏に含まれる蛍光体は同一であってもよいか異なっていてもよい。

前記蛍光層は、特別昭 61-73100号に述べられているように蛍光体を蒸剤法、スパッタリング法等の方法を用いることにより結剤剤を含有しない層状構成として支持体上に形成してもよいし、蛍光体を避当な結剤剤中に分放して盤布液を調製し、それを支持体上に整布することにより形成してもよい。この時蛍光体粒子の平均粒径は0.1~100μm、好しくは0.5~30μmである。本発明のパネルにおいて、結剤剤を用いる場合には、例えばセラナンの如き蛋白質、デキストランの如きポリサッ

本発明の蛍光体パネルに用いられる蛍光体としては、

Y,O,S:Tb、Cd,O,S:Tb、La,O,S:Tb、(Y,Cd),O,S:Tb、(Y,Cd),O,S:Tb、(Y,Cd),O,S:Eu、(Y,Cd),O,S:Eu、(Y,Cd),O,S:Eu、(Y,Cd),O,S:Eu、(Y,Cd),O,S:Eu、(Y,Cd),O,S:Eu、(Y,Cd),O,S:Eu、(Y,Cd),O,S:Eu、Y,O,S:Eu、Cd,O,S:Eu、(Y,Cd),O,S:Eu、Y,O,S:Eu、Y,O,S:Eu、Cd,O,S:Eu、(Y,Cd),O,S:Eu、Y,O,S:Eu、Y,O,S:Eu、Y,O,S:Eu、Y,O,S:Eu、Y,O,S:Eu、Y,O,S:Eu、Y,O,S:Tb、LaOCe:Tb、LaOCe:Tb、LaOCe:Tb、LaOCe:Tb、LaOCe:Tb、CaHO.、CaHO. CaHO. Caho.

しかし、本見明のパネルに用いられる近光体は、 前述の世光体に限られるものではなく、 X 線照射 時に発光を示す近光体であればいかなる蛍光体で

カライドまたはアラビアゴム、ポリビニルブナラート、ポリ酢酸ビニル、ニトロセルロース、エチルセルロース、塩化ビニリデン-塩化ビニルコポリマ、ポリノチルノタクリレート、塩化ビニル-酢酸ビニルコポリマ、ポリウレタン、セルロースアセテートブチラート、ポリビニルアルコール等のような過常層構成に用いられる結準剤が使用される。

しかし、本発明のパキルに関しては、とくに前 記特開昭 61-73100号において提案されているよう に、 蛍光圏が結婚削を含有しない構造を有するこ とが好ましい。 結婚削を含有しない蛍光圏の形成 法としては、以下のような方法があげられる。

第1の方法として蒸剤法かある。該方法においては、まず支持体を蒸剤装置内に設置した複裝型内を排気して10-*Torr程度の真空度とする。次いで、前配蛍光体の少なくとも一つを抵抗加熱法、エレクトロンビーム法等の方法で加熱蒸発させて前記支持体表面に蛍光体を所望の厚さに堆積させる。

この結果、結別別を含有しない蛍光圏が形成されるが、前記蒸剤工程では複数回に分けて蛍光圏

を形成することも可能である。また、前 記 蒸 効 工程では 複数の 抵抗 加 然 器 あるいはエレクト ロンピームを用い て 共 蒸 剤 を 行うことも 可能で ある。

また、前記蒸泊法においては、低光体原料を複数の抵抗加熱認めるいはエレクトロンピームを用いて非蒸泊し、支持体上で目的とする低光体を合成すると同時に低光層を形成することも可能である。

さらに前記蒸剤法においては、蒸剤時、必要に応 じて被蒸剤物を冷却あるいは加熱してもよい。ま た、蒸剤終了後低光層を加熱処理してもよい。

第2の方法としてスパッタリング法がある。該方法においては、蒸剤法と同様に支持体をスパッタ装置内に装置した後装置内を一旦排気して10⁻゚
Torr程度の真空皮とし、次いでスパッタリング用のがスとしてAr,Ne等の不活性がスをスパッタ装置内に導入して10⁻³Torr程度のかス圧とする。

次に、前記蛍光体をターゲットとして、スパッタリングすることにより、前記支持体表面に蛍光体を所図の厚さに堆積させ、前記蒸泊法と同様に蛍

ースなどのセルロース誘導体、あるいはポリノチ
ルノタクリレート、ポリピニルブチラール、ポリピニ
ルホルマール、ポリカーボネート、ポリ酢酸ビニ
ル、ポリアクリロニトリロニトリル、ポリノチルロ
ースジアセテート、セルローストリアセテート、ポリ
リルアルコール、ポリアクリル酸、ポリノタク
リル酸、ポリグリシン、ポリアクリルア、ポリエテレン、ポリエ
ンテレフタレート、ポリエチレン、ポリエチレン、ポリ
アン、ポリ塩化ビニル、ポリアミド(ナイロン)、ポリアロピレン、ポリ三那化一塩化エチレン、ポリアロピレン、ポリアニルにアーカル・ポリス
チレンなどかあげられる。

また、特別昭 61-176900号に述べられているように放射級硬化型切開または無硬化型切開の少なくともいずれか一方を含有する遊布液を保護層を設置すべき面に弦布し、特別昭 61-176900号に示したような装置を用いて架外級あるいは電子級など

光暦も形皮することができる。

外3の方法としてCVB法か为る。該方法は目的と する世光体あるいは世光体原料を含有する有限金 風化合物を熱、商周被電力等のエネルギで分解す ることにより、支持体上に精力剂を含有しない低 光層を得る。

第4の方法として吹菊け法がある。該方法は飲 光体粉末を粘剤層上に吹き菊けることにより支持 体上に粘剤剤を含有しない飲光層を得る。

本発明のパネルの蛍光層の層厚は、目的とするパネルのX級に対する感度、蛍光体の揺気等によって異なるが、粘溶剤を含有しない場合で80μェ~1000μェの範囲、さらに好ましくは100μェ~800μェの範囲から選ばれるのが好ましく、結溶剤を含有する場合で100μェ~1000μェの範囲、さらに好ましくは100μェ~500μπの範囲から選ばれるのが好ましい。

本発明に於ては前配のような保護層を設けることが好ましい。保護層用材料としては、たとえば 酢酸セルロース、ニトロセルロース、エチルセルロ

の放射線の照射および/または加熱を施して前配 塗布很を硬化させてもよい。

前記放射級硬化型例面としては、不飽和二重結合を有する化合物またはこれを含む組成物であればよく、このような化合物は、好ましくは不飽和二重結合を2個以上有するブレポリマおよび/またはオリゴマであり、さらに、これらに不飽和二重結合を有する単量体(ビニルモノマ)を反応性希釈剤として含有させることができる。

前記のように形成される保護層の一層の層厚は 0.5μ x ~ 1000 μ x 程度、 さらに好ましくは 1 μ x ~ 50μ x 程度の 配囲にあることが好ましい。また SiO,, SiC, SiN, Al, O, 等の無機動型層を真空蒸剤法、 スパッタリング法等により形成してもよい。 前記無機動質層の層厚は 0.1μ x ~ 10μ x 程度が好ましい。

本発明のパネルは、支持体上に蛍光層を設けた後に該蛍光層上に保護層を形成して製造してもよいし、あらかじめ形成した保護層を前記蛍光層上に付取して製造してもよい。あるいは保護層上に蛍光層を形成した後、支持体を設ける手順をとっ

てらよい.

尚保設限には飲光スペクトル領域に有害な吸収がないことが好ましい。

【実施例】

次に、実施例によって本発明を説明する。 実施例1

支持体として500μ a 好の化学強化ガラスを蒸剤 器中に設置した。次に抵抗加熱用のタングステン ボート中にアルカリハライド蛍光体(Csl:0.003Na) を入れ、、抵抗加熱用電極にセットし、緑いて蒸 剤器を排気して2×10⁻⁴ Torrの真空度とした。

次にタングステンポートに忽放を挽し、抵抗加 別法によってアルカリハライド蛍光体を蒸発させ 化学強化ガラス上に蛍光周の周厚が300μzの厚さ になるまで堆積させた。

次にこのパネルを大気中に取出した後、化学強化ガラスの呼尽層の設けられていない面に、ポリイミドフィルム上に ITOを蒸着した導電数シート(ミクロ技術研究所製、10Ω/□)を接着し、また蛍光層表面には 20μ x 厚の透明ポリエチレンテレフタ

実施例 1 で作製したベネル Aの蛍光層を加熱しないで 30℃で相対温度70%の恒温室に放置し、経時による速度変化を測定した結果を第 6 図画線 pとして示す。

第6図より、本発明のパネルは近光層を加熱することによって吸湿による感皮の低下を防止し、 耐用性が保証される。

灾施例 4

アルカリハライド 蛍光体 (0.9 Rb Br・0.1 Cs 1: 0.0001/T!) 8 担 显 部 と ポリピニ ルブ チラール 例 服 1 重 益 部 と 治 剤 (シクロ へき サノン) 5 重 量 部 を 用いて 混合・分 敵 し、 蛍 光 層 用 益 布 根 を 阿 製 した。 次にこの 強 布 根 を 水 平に 置い た 500 μ a 厚の 化 学 強化 か ラ ス 支 持 体 上 に 均 ー に 並 布 し、 自 然 乾燥 さ せ て 300 μ a 厚 の 即 尽 層 を 形 成 した。

このようにしてねられたパネルの化学強化ガラスの蛍光層の設けられていない面に実施例1と同様の導電性シートを接着し、また蛍光層表面には20μ a 厚の透明ポリエチレンテレフタレートシートを接着して本発明のパネルCを得た。

レートシートを接着して、外1図(b)に示した構造 の本発明のパネルAを得た。

このパキルAに電極と第3図の様な温度制作回路を取付け、80℃に蛍光層を加熱しながら、30℃、和村程度70%の恒温室に放回し、経時による感度変化を測定した結果を第6図曲線。に示す。

実施例 1 において、蛍光層の加熱を140℃にした以外は実施例 1 と同様にして経時による感度変化を測定し、第 6 図曲線 bをえた。

突施例1において、支持体として予め飲光層を設ける側に透明導電級(ITO,10 Q/□)が蒸溜されている500μ z 厚の化学強化がラスを用いた以外は実施例1と同様にして本発明のパネルBを存た。 尚透明導電級上には透明導電級と蛍光体との反応を防止するためのSiO級(2000Å)が設けてある。次にこのパネルBの経時による感度変化を実施例1と同様にして測定し、第6図曲線Cとして示す。比較例1

実施例1のパネルAと本実施例のパネルCとを30 Cで相対温度80%の但温室に十分長期間放置した 後、30℃で相対温度60%の但温室に取り出し、外 3 図の様な温度制御回路を取付け、蛍光層を80℃ に加熱して前記パネルA,Cの感度回復の様子を調べた。結果を第8 図曲線d(パネルA)、曲線e(パネルC)として示す。

比較例 2

実施例3

実施例1のパネルAを実施例4と同様に30℃で相対湿度80%の恒湿室に十分長期間放置した後、30℃で相対湿度80%の恒湿室に取り出し、供光層を加熱しないで前配パネルAの感度回復の様子を調べた。結果を第7図曲線gとして示す。

第7 図より、本発明のパネルは吸湿により一旦 燃度が低下しても、蛍光層の加熱により燃度が回 復することがわかる。尚、本発明のパネルのうち パネル Aは蛍光層に結剤剤を含んでいないので、 感度の回復が早い。

【発明の効果】

以上述べたように加熱機構を内蔵させた本発明

のパネルは、

- (2) 加熱することにより低光体に吸力された水分が放出され、水分吸力による低光体の劣化性化が回復する。
- (3) 加州することにより、長寿命歿先を引きおこすトラップレベルが減少してS/Nが向上する。

等の好ましい挙動を有し、パキルの耐用性か上 る。

4. 図面の簡単な説明

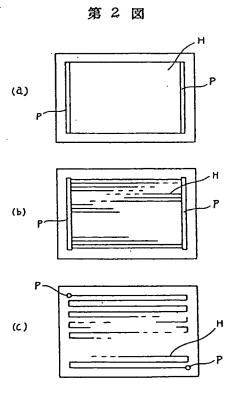
第1図は本発明のパネルの塑体例の断面図である。第2図は発然体の回路パターンを示す図、第3図は温度初毎のブロック図である。

第4図はバネル蛍光周の除湿効率を示す図であり、第5図は蛍光層の含水率と感度の関係を示す図である。

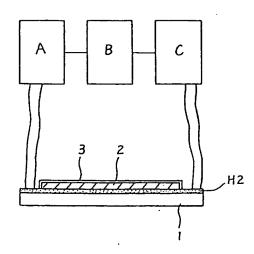
第6図は防湿に対する温度効果を示し、第7図 は加熱による感度回復挙動を示すグラフである。

H 3 … 支持発熱体。

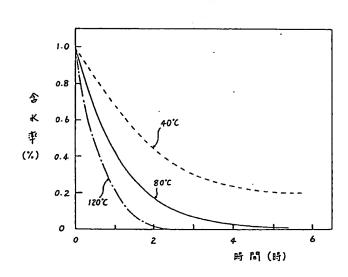
出期人 小西六写真工祭株式会社



第 4 図



A: 温度授出器 B: 温度制御器 C: ビータ用電源 H2: 発热層



第 5 図

第 7 図

